



情報検索委員会

CPCの最新状況とWIPO訪問団報告

6/23 関東部会

6/25 関西部会



CPCの最新状況

◆ 中国、韓国への付与状況

- 2015年1月には「75分野の分類に付与」とアナウンスされているが、各庁が付与したCPCは一部の公報のみ

◆ USCの廃止状況

- 2015年3月には、「まもなくUSPCが付与された公報は発行されなくなる」とアナウンスされているが、現状（2015年5月末時点）は、USCは付与されている

◆ PCT案件の付与状況

- 受理官庁別(5極+WIPO)の付与率は95%以上
- 日本語PCT出願案件にも付与されている





今回の訪問までの経緯

- ◆ 2012, 2013年 : EPO PIC に参加
(Patent Information Conference)
 - PDGのWG “IMPACT” と連携開始
(Impact of patent laws on documentation)
 - EPO・USPTOの特許分類責任者と意見交換

CPCとFIが乖離する問題を提起

- ◆ 2014年 : PDGから65th IMPACT meeting に出席要請
EPO East meets West 2014 と併せて参加
 - CPCとFI/Fチームの調和実現に向けて、そのメリットをPDG及びEPO
に対して、日本特許ユーザーの代表としてプレゼンテーション

CPCとFIの調和を推進





2015年 訪問内容

- ◆ **特許分類調和に対するWIPOへの提言**
 - 次回IPC改正によるCPCとFIの調和を提言
 - ファミリー付与観点を考慮した分類コンコーダンス機能の改善を要望

- ◆ **PDG IMPACT Meetingへの参加**
 - CPC関連研究の進捗報告
 - 分類調和へ向けたWIPOへの提言紹介
 - EPO分類担当者にCPCの最新状況を確認

- ◆ **ip-search 訪問**
 - スイス特許庁の調査部門であるip-searchにて、サーチスキルをヒアリング





WIPO訪問

◆ 概要

- 日程、場所：4/20 @ WIPO本部, Geneva
- 参加者：事務局長補・グローバルインフラ担当
高木氏
：分類担当者
Antonios Farassopoulos 氏、Ning Xu 氏



◆ 内容

- 次回IPC改正によるCPCとFIの調和を提案
- ファミリー付与観点を検討した分類コンコーダンス機能の改善を要望

◆ 成果

- 調和への進捗は、各庁の意向が合わないことも多々あり遅れている。そのためコンコーダンスの改善は前向きに取り組みたい
- 委員会の研究成果である「テーマコード⇔CPC対応表」をWIPOに提供して、WIPOのコンコーダンス機能の改善に協力していく





PDG IMPACT meeting 2015

◆ 概要

- 日程：4/16、17
- 場所：Hotel Russell, London
- 参加者：41名 PDGメンバ、各国特許庁、各ベンダ



◆ 内容

- CPCとFIを対比させた俯瞰的な分析結果を紹介。IPCをベースとすれば、その差は半分以下のため、スーパーセットの候補として最適と考える旨を主張ファミリー付与観点を検討した分類コンコーダンス機能の改善を要望
- JIPAのCPC研修の教材を Nelson das Neves氏 (EPO)に紹介

◆ 成果

- CPC分類担当者とのパスを構築。今後もコンタクトを取り最新情報を取得する

<コメント>

JIPAがCPCの研修をしていることが大変興味深い。日本のCPCユーザーの声を直接聞ける機会なので、研修に参加したい。





ip-search 訪問

◆ 概要

- 日程、場所 : 4/21 @ip-search, Bern
- 参加者 : Yvonne Schumacher氏 (IEG)
Markus Funk氏, Jochen Spuck氏 (ip-search)

◆ 内容

- ip-searchの紹介。特にEPO審査間端末を利用した世界検索のデモ。
- 欧州言語（仏、独語）でのサーチ能力、読込能力は高いと思われる。





Epoque-net (公報確認画面)

The screenshot displays the Epoque-net software interface with the following features and annotations:

- Search Results:** The left pane shows search results for document EP1658796. Text is color-coded by classification (Bibliography, EPO, WPI, etc.).
- Annotations:**
 - Colour highlighting of search terms:** Points to highlighted words like 'heating' and 'frothing'.
 - Marking of relevant text sections:** Points to specific paragraphs in the description.
 - Machine-readable full text:** Points to the full text of a paragraph.
 - Highlighting of search terms:** Points to search terms within the text.
- Technical Diagram (Fig. 8.9):** A schematic diagram of a coffee machine component with numbered parts (62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78). A callout box labeled 'Document in facsimile format' points to the diagram.
- Translation Function:** A 'Yellow sticker' window on the right shows a list of terms and their translations (e.g., 'Schäumen: j', 'Heizen: j', 'Milch: j'). A 'Comment' box is also present.

検索では

- あらゆる分類、キーワードが入力可能
- 一度に複数国の文献が検索可能





以下、プレゼンテーション抜粋





JIPAの発表内容(2014年度)

◆ CPCとFIの階層構造の比較 - FIが優位(分類数が多い)の技術分野

< 付録 3 > H01L21/302の分析結果 (半導体装置のエッチング技術)

CPC 分類数 -> 4

H01L 21/302 to change their surface-physical characteristics or shape, e.g. etching, polishing, cutting
H01L 21/304 Mechanical treatment, e.g. grinding, polishing, cutting {(H01L 21/30625 takes precedence)}
H01L 21/3043 Mechanical treatment, e.g. grinding, polishing, cutting {(H01L 21/30625 takes precedence)}
H01L 21/3046 {using blasting, e.g. sand-blasting (H01L 21/2633 takes precedence)}

< FI 分類数 -> 37

H01L 21/302 to change their surface-physical characteristics or shape, e.g. etching, polishing, cutting [2]
H01L 21/302 100 Plasma etching
H01L 21/302 101 Plasma etching systems
H01L 21/302 101 B	Parallel flat plate systems (including capacitive coupling type, RIE, two-frequency systems)
H01L 21/302 101 C	Inductive coupling systems (including TCP (R), ICP, helicon wave systems)
H01L 21/302 101 D	Microwave and UHF wave exciting systems (including ECR, cavity resonance systems; including systems generally using microwaves)
H01L 21/302 101 E	Local plasma (including atmospheric discharge, PACE, chemical vapor machining (CVM))
H01L 21/302 101 F	Wafer lamination batch processing systems (including barrel, etching tunnel systems)
H01L 21/302 101 H systems (including substrate cooling mechanisms, heating mechanisms, heating chucks, pipes, process-to-process transportation, process simulation, communication with other semiconductor manufacturing facilities)
H01L 21/302 101 H	System cleaning (including wall cleaning, aging)
H01L 21/302 101 M	Improvement of maintainability (technology necessary for disassembly and cleaning of systems and replacement of consumable parts)
H01L 21/302 101 L	Material of electrodes (including inventions for designing electrode materials such as glassy carbons or describing electrode formation methods)
H01L 21/302 101 R	Back side gas supply (including technologies for supplying thermally conductive gas to the portion that will closely contact back face of treated substrate to improve thermal conduction)
H01L 21/302 101 Z	Others
H01L 21/302 102 Substrate cleaning (plasma cleaning including substrate surface cleaning; plasma cleaning H01L21/302 and 106)
H01L 21/302 103 End point detection and monitoring (for etching end point detection, spectroscopic analysis, mass detection, detected waveform)

FIと比較して、CPCは分類数が少ない

この分類は、FIが優位





JIPAの発表内容(2014年度)

◆ CPCとFIの階層構造の比較 - CPCが優位(分類数が多い)の技術分野

< APPENDIX 2 > Analysis for B41J2(Ink Jet Printer)

CPC entry -> 220

FI entry -> 36

CPC Classification	FI Classification
B41J 2/01 Ink jet	Entry FI
B41J 2/015 ... characterised by the jet generation process (B41J 2/21)	B41J 3/00 101 ... Recording head
B41J 2/02 ... generating a continuous ink jet	B41J 3/00 102 ... Recording device drive
B41J 2/025 ... by vibration	B41J 3/02 ... for building-up characters by writing or by
B41J 2/03 ... by pressure	B41J 3/04 ... by moving styli or their equivalent or writing jets
B41J 2/035 ...	B41J 3/04 101 ...
B41J 2/04 ...	B41J 3/04 101 Z Others
B41J 2/045 ...	5 B41J 3/04 101 Z Others
B41J 2/04501 ... { Control methods or devices therefor, e.g. driver	6 B41J 3/04 102 ... Ink supply device
B41J 2/04503 ... { aiming at compensating carriage speed}	7 B41J 3/04 102 N Nozzle driving prevention
B41J 2/04505 ... { aiming at correcting alignment}	8 B41J 3/04 102 H Head cleaning
B41J 2/04508 ... { aiming at correcting manufacturing tolerances}	9 B41J 3/04 102 R Unnecessary ink collection
B41J 2/04508 ... { aiming at correcting other par	Others
B41J 2/0451 ... { for detecting failure, e.g. cloggi	... Ink particle forming device
B41J 2/04511 ... { for electrostatic discharge pr	Pressure control systems in general
B41J 2/04513 ... { for increasing lifetime}	13 B41J 3/04 103 B ... Bubble jet (R) tvee
B41J 2/04515 ... { preventing overheating}	14 B41J 3/04 103 D ... Diaphragm tvee
B41J 2/04516 ... { preventing formation of satellite drops}	15 B41J 3/04 103 C using air flow
B41J 2/04518 ... { reducing costs}	16 B41J 3/04 103 E Vibration control system (continuous tvee)
B41J 2/0452 ... { reducing demand in current or voltage}	17 B41J 3/04 103 F Stylus system using a magnetic fluid
B41J 2/04521 ... { reducing number of signal lines needed}	18 B41J 3/04 103 G Electrostatic or magnetic suction system
B41J 2/04523 ... { reducing size of the apparatus}	19 B41J 3/04 103 S using thermally fused ink (solid ink)
B41J 2/04525 ... { reducing occurrence of cross talk}	20 B41J 3/04 103 T (using the ink carrier such as the porous sheet
B41J 2/04526 ... { controlling trajectory}	21 B41J 3/04 103 H Head assembly or manufacture
B41J 2/04528 ... { aiming at	27 B41J 3/04 104 B Electrical field control tvee
B41J 2/2132 ... { Print quality control characterised by dot disposition,	28 B41J 3/04 104 C Phase search or control (takes precedence over F.)
B41J 2/2135 ... { Alignment of dots (adjustments by bodily moving pri	29 B41J 3/04 104 D Flving control against relative moving between the
B41J 2/2139 ... { Compensation for malfunctioning nozzles creating	30 B41J 3/04 104 F Flving control using feedback control
B41J 2/2142 ... { Detection of malfunctioning nozzles (for cleaning p	31 B41J 3/04 104 G Flving control using distortion correction
B41J 2/2146 ... { for line print heads}	32 B41J 3/04 104 H Flving control characterized by processing of the dot
	33 B41J 3/04 104 F Charging or deviation electrode
	34 B41J 3/04 104 K Detection electrode or detection device
	35 B41J 3/04 104 X Flving control for concentration or gradation
	36 B41J 3/04 104 Z Others

CPCの分類数の方がFIより多い。FIは旧IPCを基本としている。

CPCは多くの観点からなる

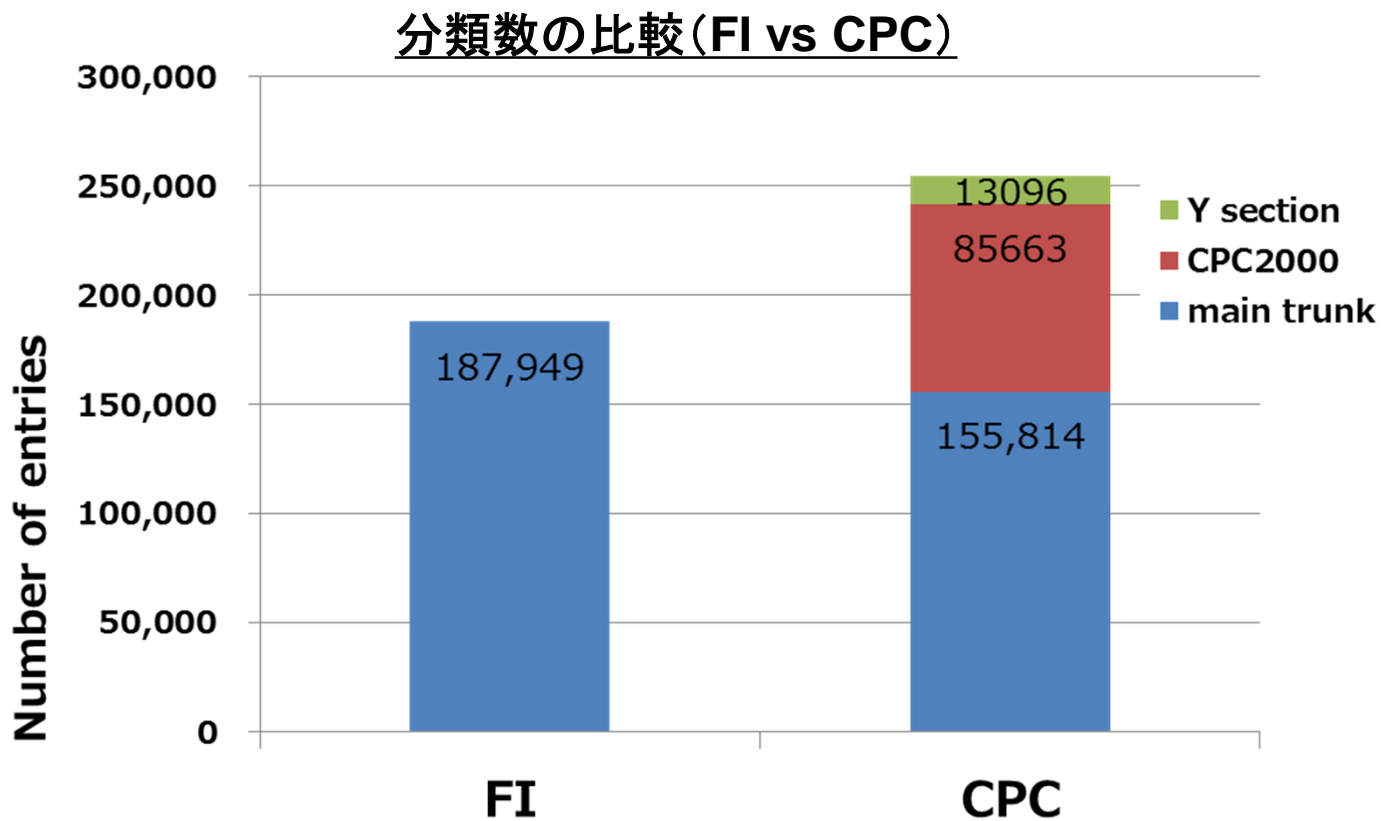
この分類はCPCが優位！





分類数の比較 (FI vs CPC)

◆ 主要部分の分類数は、ほぼ同じ





CPCとFIのコンコードダンス表の作成

- ◆ CPC→IPC(CPC サイトより)、FI→IPC(JPOサイトより)コンコードダンス表を元に、同じIPCをキーとして、コンコードダンス表を作成した
 - このコンコードダンス表を用い、FIとCPCの階層の違いを検証した

FI		IPC			CPC		
1	FI (分類数)	IPC (分類数)	IPC (分類数)	IPC (分類数)	CPC (分類数)	G	H
5280		0	A61 B18/28	熱プローブまたは熱吸収体を熱するためのもの [7]	A61 B18/28;	1	
	A61 B 19/00 ¥; A61 B 19/00 501 ¥; A61 B 19/00 502 ¥; A61 B 19/00 503 ¥; A61 B 19/00 504 ¥; A61 B 19/00 505 ¥; A61 B 19/00 506 ¥; A61 B 19/00 507 ¥; A61 B 19/00 508 ¥; A61 B 19/00 509 ¥; A61 B 19/00 510 ¥; A61 B 19/00 511 ¥; A61 B 19/00 512 ¥; A61 B 19/00 513 ¥; A61 B 19/00 514 ¥;	15	A61 B19/00	A61 B1 / 00 ~ A61 B18 / 00 のグループのどれにも包含され ない手術または診断のための機 器、器具、または補助具、例、定 位脳手術、不好手術、脱臼処 置、傷口保護具のためのもの (保護用の顔面マスクA41D13 /11; 外科医または患者用のガ ウンまたは衣類A41D13/12; 体液を除去、処理または導入す る用具A61M1/00)	A61 B19/00; A61 B19/20; A61 B19/201; A61 B19/203; A61 B19/22; A61 B19/2203; A61 B19/24; A61 B19/26; A61 B19/28; A61 B19/30; A61 B19/34; A61 B19/36; A61 B19/38; A61 B19/40; A61 B19/42; A61 B19/44; A61 B19/46; A61 B19/50; A61 B19/52; A61 B19/5202; A61 B19/5212; A61 B19/5223; A61 B19/5225; A61 B19/5244; A61 B19/54; A61 B19/56; A61 B2019/202; A61 B2019/204; A61 B2019/205;	191	

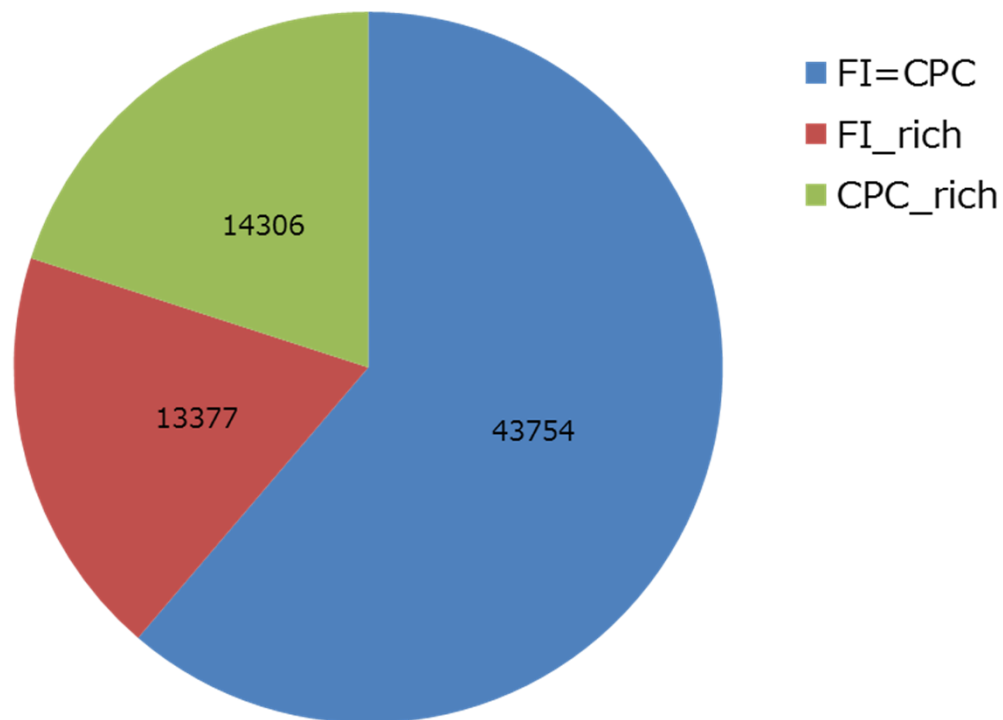




CPCとFIの分類数の大小比較

◆ 階層が異なる範囲は半数以下

同じIPC配下（サブグループ以下）でのCPCとFIの分類数を比較

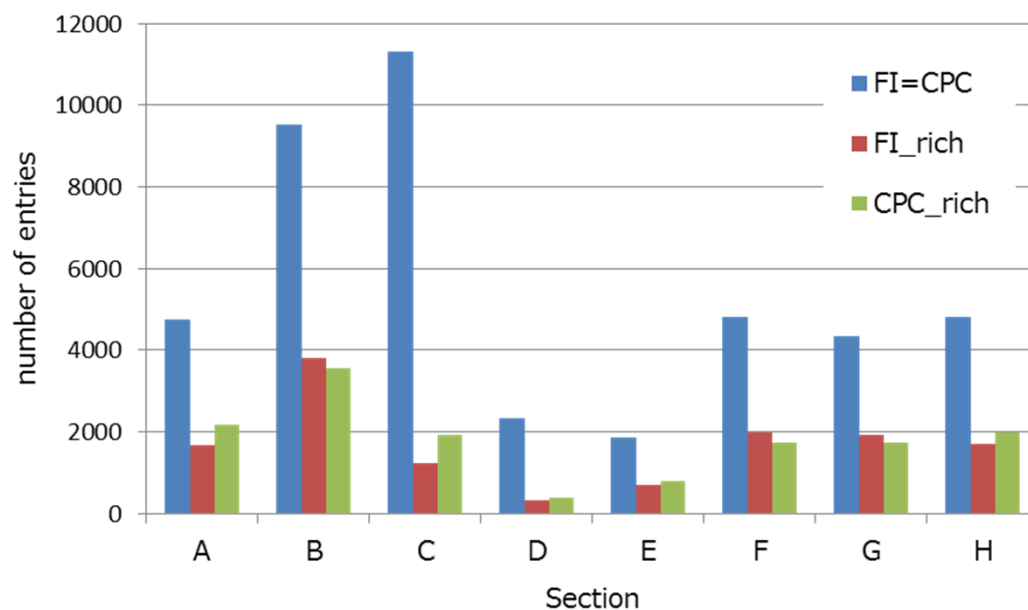




CPCとFIの分類数の大小比較(セクション別)

- ◆ Cセクション、Dセクションは、「CPCとFIの分類数が同じ」割合が多い

同じIPC配下(サブグループ以下)でのCPCとFIの分類数を比較 <セクション別>



IPCは、CPCとFIの分類を吸収するスーパーセットになりえる



テーマコードとCPCのマッピング表

FIと付与観点異なる場合のCPCを確認することができる

1	テーマコードとCPCのマッピング表										
2	テーマコード			FI			CPC				
3	PatBase]で「特許数1」が5000件										
4	主キー	DB	テーマコード (フィルタ)	テーマ コード	特許数1	解析	テーマ名	FIカバー範囲	CPC	特許数2	CPCスキーム
13707	13703	PatBase	3F500	3F500	1145	FI	物流システム	B65G61/00,100-61/00,550			
13708	13704	PatBase	3F500						G06Q10	557	Administration; Management
13709	13705	PatBase	3F500						G06Q30	184	Commerce, e.g. shopping or e-commerce
13710	13706	PatBase	3F500						G06Q20	122	Payment architectures, schemes or protocols; payment transactions G07F7/08, G07F19/00
	13707	PatBase	3F500						G05B19	116	Programme-control systems (specific applica A47L15/46; clocks with attached or built-in n preselected time interval G04C23/00; marking digital information G06K; information storage switches which automatically terminate their completed H01H43/00)
13711											
13712	13708	PatBase	3F500						G05B2219	91	Program-control systems
13713	13709	PatBase	3F500						G07B2017	62	
13714	13710	PatBase	3F500						G07B17	61	Franking apparatus(printing aspects B41)
13715	13711	PatBase	3F500						G06K17	56	Methods or arrangements for effecting co-op covered by two or more of the preceding main incorporating conveying and reading operatio
	13716	PatBase	3F500						G06K2017	53	
13717	13713	PatBase	3F500						G06F17	43	Digital computing or data processing equipme specific functions

テーマコード内の文献に付与されるファミリー
情報から、付与されているCPCをランキング

テーマコード:3F500
物流システム

FI:B65G61/00,100-61/00,550
サプライチェーン・マネジメント (S C M) に関するもの





テーマコードとCPCのマッピング表

PATENTSCOPEの「IPC / CPC / FI Parallel Viewer」機能にテーマコードとCPCのマッピング表の追加を要望

<イメージ図>

WIPO IP SERVICES International Patent Classification (IPC) Official Publication

Fransais
 Contact us | Accessibility | Site map

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

IPC Home Page - Help

Version: 2015.01

Current symbol:

Go to:

Language: English French English/French

View mode: path full hierarchic

Show CPC/FT

Notes

Search:

Scheme RCL Compilation Catchwords Guide to the IPC

テーマコード	特許数1	解析	テーマ名	Fカバー範囲	CPC	特許数2	CPCスキーム
3F500	1145	FI	物流システム	B65G61/00,100-61/00,550			
					G06Q10	557	Administration; Management
					G06Q30	184	Commerce, e.g. shopping or e-commerce
					G06Q20	122	Payment architectures, schemes or protocols (payment transactions G07F7/08, G07F19/00)
					G05B19	116	Programme-control systems (specific applications A47L15/46; clocks with attached or built-in memory preselected time interval G04C23/00; marking digital information G06K; information storage devices G06F; switches which automatically terminate their operation G06F1/00; completed H01H43/00)
					G05B2219	91	Program-control systems
					G07B2017	62	
					G07B17	61	Franking apparatus (printing aspects B41)
					G06K17	56	Methods or arrangements for effecting co-operation covered by two or more of the preceding main classes incorporating conveying and reading operation
					G06K2017	53	
					G06F17	43	Digital computing or data processing equipment performing specific functions

ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

